

**強誘電HfO<sub>2</sub>技術の最新動向**  
**～プロセス・物性からデバイス・回路応用まで～**  
**日時：2018年9月20日（木）13:30～**

近年大きな注目を集めている強誘電HfO<sub>2</sub>技術に関して、プロセス・物性・デバイス・回路応用の各分野で牽引している研究者の皆さんに講演をお願いし、領域を横断した議論を行います。

**【招待講演者（敬称略）】**

舟窪 浩（東工大）  
藤村 紀文（大阪府大）  
鳥海 明（東大）  
生田目 俊秀（NIMS）  
太田 裕之（産総研）  
小林 正治（東大）

**【企画】**

13.3 絶縁膜技術  
13.5 デバイス／集積化技術  
6.1 強誘電体薄膜

**【世話人】**

齋藤 真澄（東芝メモリ）  
藤井 章輔（東芝メモリ）  
山田 智明（名古屋大学）  
恵下 隆（和歌山大学/富士通セミコンダクター）